【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)

【公表番号】特表2003-532697(P2003-532697A)
【公表日】平成15年11月5日(2003.11.5)
【出願番号】特願2001-582257(P2001-582257)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｃ　7/163　(2006.01)
Ｃ０７Ｃ　5/05　(2006.01)
Ｃ０７Ｃ　11/02　(2006.01)
Ｃ０７Ｂ　61/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｃ　7/163
Ｃ０７Ｃ　5/05
Ｃ０７Ｃ　11/02
Ｃ０７Ｂ　61/00　３００

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月28日(2008.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　オレフィン流れを精製する方法であって、
炭素原子８～３６個の平均分子鎖長を有し、ある量のジエン類を含むオレフィン供給原料を提供すること、
前記オレフィン供給原料をジエン被毒に感受性の高い水素化触媒および水素を含むガスフィードに、ある供給原料流速および前記ジエン類の大部分をオレフィン類に変換するのに有効な条件下で接触させること、を含む方法。
【請求項２】　前記平均分子鎖長が少なくとも炭素原子１０個である請求項１に記載の方法。
【請求項３】　前記供給原料流速が１ＬＨＳＶ以下である請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】　オレフィン流れを精製する方法であって、
炭素原子１０～２０個の平均分子鎖長を有し、ある量のジエン類を含むオレフィン供給原料を提供すること、
前記オレフィン供給原料を、不活性ガスおよび２～６容積％の水素を含むガスフィードの存在下、ジエン被毒に感受性の高い水素化触媒に、前記ジエン類の大部分をオレフィン類に変換するのに有効な条件下で１ＬＨＳＶ以下の供給原料流速で接触させること、を含む方法。
【請求項５】　前記水素化触媒が固定層を構成する請求項１、２、３または４に記載の方法。
【請求項６】　前記水素化触媒がパラジウムを含む請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】　前記水素化触媒が適切な担体に担持されている約０．２重量％のパラジウムを含む請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】　前記担体が２～５m^2／ｇの表面積を有するアルミナを含んでなる請

求項７に記載の方法。

【請求項９】　オレフィン流れを精製する方法であって、

前記オレフィンが炭素原子１０～２０個の平均分子鎖長および分子鎖当たり少なくとも０．７の平均分枝数を有し、ある量のジエン類を含むオレフィン供給原料を提供すること、

前記オレフィン供給原料を不活性ガスおよび２～６容積％の水素を含むガスフィードの存在下で固定層水素化触媒と接触させることを含み、ここで前記水素化触媒はアルミナに担持されている０．０５重量％～０．２重量％のパラジウムを含み、前記アルミナは１５m^2／ｇ以下の表面積を有している、

ここで、前記オレフィン供給原料は前記ジエン類の大部分をオレフィン類に変換するのに有効な条件下で１ＬＨＳＶ以下の前記固定層を通過する流速を有する、前記方法。

【請求項１０】　前記方法が、４０％以下のジエン類および１重量％以下の含量のパラフィンを含む精製オレフィン流れを生成する請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。